

高真空蒸着装置 ED-1500



高真空蒸着装置ED-1500は水晶振動式膜厚計搭載型抵抗加熱蒸着装置です。

将来的に3元用電子銃の増設が可能。

研究機構向けに開発された本装置は、抵抗加熱機構3対(切替式)を装備し、真空状態のまま多層膜が可能です。

また排気系はターボ分子ポンプを採用しておりますので、クリーンな排気が可能です。

基板ヒーターはマイクロセラミックヒーターを採用しておりますので、300°C迄短時間で昇温します。

基板回転機構も標準搭載した本装置は、膜厚分布の精度も±10%以内となっております。

高真空蒸着装置ED-1500仕様

- 到達圧力 7.0×10⁻⁴Pa以下※常温・無負荷時
- 排気速度 ×10⁻³Pa台迄排気開始後30分以内※常温・無負荷時
- 真空漏洩量 1.0×10⁻¹⁰Pa・m³/sec Heリークデテクター検査
- 真空室径 φ500mm×550mmH SUS304
- 蒸着機構 抵抗加熱方式3対切替式(ポート)
AC10V0~150A
制御方式:サイリスタ制御
電流計・可変ボリューム
- 基板形状 φ210mm
- 基板回転 モーター直接駆動方式 0~19rpm[50Hz]
- 基板加熱 常温~300°C迄昇温可能
制御方式:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:670L/min[50Hz]
ターボ分子ポンプ:300L/sec
- 真空計 広帯域真空計
- 操作方法 手動/自動(排気系の立ち上げ/蒸着準備/ベント/排気系の立ち下げ:4種類)
- ユーティリティ電気:AC200V三相4.0KVA
冷却水:3.0L/min以上0.03MPa以上0.1MPa以下25°C以下循環
寸法: 装置架台本体:990mmW×840mmD×(1930)mmH
制御盤:570mmW×700mmD×(1820)mmH
- オプション 3kW3連E型電子銃(ルツボ容量:2.2cc 出力電圧:DC-5kV 出力電流:DC0~1A)

